

(社)日本応用磁気学会 第2回化合物新磁性材料専門研究会

## 「希薄磁性半導体における強磁性の発現」

(InMn)As、(GaMn)As などの III-V 族系半導体における強磁性の発見によって広く注目を集めるようになった希薄磁性半導体研究も、近年では酸化物系やカルコパイライト系半導体などをベースとする新しい希薄磁性半導体が発見され、物質のバリエーションという観点からも研究の広がりを見せています。本研究会では、様々な物質系を対象とした、希薄磁性半導体研究の最近の発展に関して一線の研究者の方々にご講演いただきます。講演者の方々には、大学院生や他の分野の研究者にもわかるような講演をお願いしてありますので、専門外の方も含めて、皆様、奮ってご参加ください。

**日時:** 平成13年7月27日(金) 13:30 - 17:15

**場所:** 東京大学工学部6号館3階セミナー室A [東京都文京区本郷7-3-1 (東京大学本郷キャンパス内)]

**参加費:** 無料

**参加申込:** 当日受付にて

**プログラム** (敬称略):

13:30-14:10 大岩顕 KAST 「III-V族磁性混晶半導体における光キャリア誘起磁性」

14:10-14:50 福村知昭 東北大金研 「透明な希薄磁性酸化物の創製

コンピナトリアル材料科学によるアプローチ」

14:50-15:30 溝川貴司 東大新領域 「希薄磁性半導体の分光」

休憩

15:50-16:30 石橋隆幸 東京農工大工 「カルコパイライト磁性半導体の作製と評価」

16:30-17:15 吉田博 (阪大産研) 「第一原理計算による磁性半導体のマテリアルデザインとデバイスデザイン」

本研究会の最新情報は、<http://go.to/newmag/>にてお知らせします。(会場案内図や講演要旨を掲載中)

詳細は下記までお問い合わせ下さい。

〒113-8656 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻 木村 剛

TEL 03-5841-6840; FAX 03-5841-8763; E-mail: tkimura@ap.t.u-tokyo.ac.jp

### 本専門研究会に関して

「化合物新磁性材料専門研究会」は、10年間活動を続けて参りました「超電導マグネティックス専門研究会」を引き継ぎ、2001年4月に発足いたしました。今後、研究の対象をひろげて、高温超伝導体、巨大磁気抵抗物質、f電子系物質、磁性半導体、ナノ磁性体など新規な磁性を示す新物質全体をカバーする予定です。(第1回の研究会は「ホウ化物」をテーマとして、5月に開催されました。)